

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第3部門第3区分
 【発行日】平成17年12月22日(2005.12.22)

【公開番号】特開2005-162947(P2005-162947A)
 【公開日】平成17年6月23日(2005.6.23)
 【年通号数】公開・登録公報2005-024
 【出願番号】特願2003-406394(P2003-406394)
 【国際特許分類第7版】

C 1 1 D 7/50

H 0 5 B 33/10

H 0 5 B 33/14

【F I】

C 1 1 D 7/50

H 0 5 B 33/10

H 0 5 B 33/14 A

【手続補正書】
 【提出日】平成17年11月4日(2005.11.4)
 【手続補正1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項1】

低分子型有機EL素子製造の真空蒸着工程において使用するマスクの洗浄液組成物であって、N, N-ジメチルホルムアミド、エチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、1, 4-ジオキサソンの群から選択される非プロトン性極性溶媒を1種または2種以上からなる、前記洗浄液組成物。

【請求項2】

洗浄液組成物に含まれる非プロトン性極性溶媒が1種類である、請求項1に記載の洗浄液組成物。

【請求項3】

低分子型有機EL素子製造の真空蒸着工程において使用するマスクの洗浄液組成物であって、N, N-ジメチルホルムアミド、エチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、1, 4-ジオキサソンの群から選択される、1種または2種以上の非プロトン性極性溶媒、およびN-メチル-2-ピロリジノンからなる、前記洗浄液組成物。

【請求項4】

低分子型有機EL素子構造が、N, N'-ジ(ナフタレン-1-イル)-N, N'-ジフェニル-ベンジジンおよび銅(I)フタロシアニンおよびトリス(8-キノリノラト)アルミニウムを含む、請求項1～3のいずれかに記載の洗浄液組成物。

【請求項5】

低分子型有機EL素子製造の真空蒸着工程において使用するマスクの洗浄方法であって、請求項1～4のいずれかに記載の洗浄液組成物を用いて、浸漬またはジェット水流により洗浄する、前記洗浄方法。

【請求項6】

低分子型有機EL素子製造の真空蒸着工程において使用するマスクの洗浄方法であって、非プロトン性極性溶媒を用いて浸漬またはジェット水流によりマスクを洗浄後、ハイドロ

フルオロエーテルによってリンスする、前記洗浄方法。

【請求項 7】

非プロトン性極性溶媒が N-メチル-2-ピロリジノンである、請求項 6 に記載の洗浄方法。

【請求項 8】

超音波洗浄を併用する、請求項 5～7 のいずれかに記載の洗浄方法。

【請求項 9】

室温で洗浄する、請求項 5～8 のいずれかに記載の洗浄方法。